

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 3 部門第 4 区分
【発行日】平成 18 年 11 月 2 日 (2006.11.2)

【公開番号】特開 2001-152335 (P2001-152335A)

【公開日】平成 13 年 6 月 5 日 (2001.6.5)

【出願番号】特願 平 11-332242

【国際特許分類】

C 2 3 C 14/50 (2006.01)

H 0 1 L 21/203 (2006.01)

H 0 1 L 21/205 (2006.01)

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 14/50 A

C 2 3 C 14/50 E

H 0 1 L 21/203 S

H 0 1 L 21/205

H 0 1 L 21/302 1 0 1 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 9 月 14 日 (2006.9.14)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 1】

その後、真空処理槽 2 内に例えばアルゴンガス等のスパッタリングガスを導入し、直流電源 4 を起動してターゲット 3 に負電圧を印加すると、真空処理槽 2 内にプラズマが生成され、ターゲット 3 の表面においてスパッタリングが行われる。